

# 極薄ウェーハを用いた a-Si:H/c-Siヘテロ接合型太陽電池の検討

<sup>1</sup>産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター 先進プロセスチーム

<sup>2</sup>筑波大学

<sup>3</sup>産業技術総合研究所 再生可能エネルギー研究センター

<sup>4</sup>コマツNTC(株)

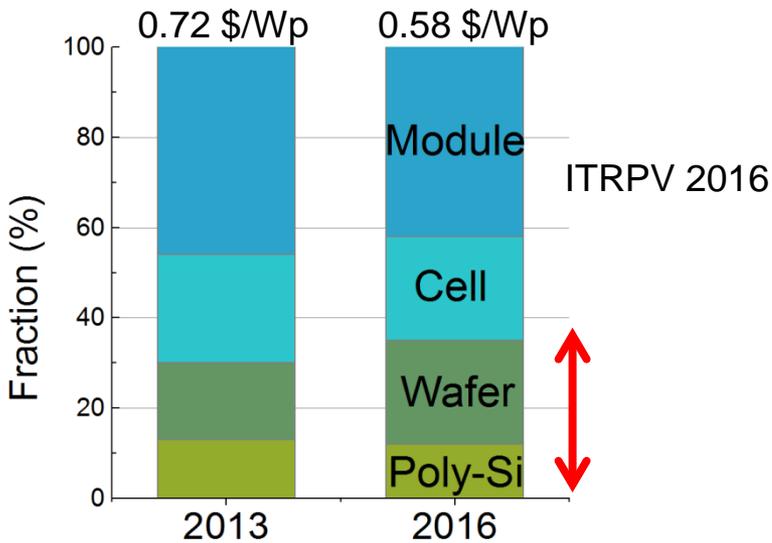
齋 均<sup>1,3</sup>、海汐 寛史<sup>1,2</sup>、松井 卓矢<sup>1,3</sup>、布村 正太<sup>1,3</sup>、  
高遠 秀尚<sup>3</sup>、河津 知之<sup>4</sup>、松原 浩司<sup>1,3</sup>

# 概要

1. はじめに
2. 極薄ウェーハの光吸収の検討  
     $J_{SC}$ 期待値
3. 極薄a-Si:H/c-Siへテロ接合セル  
     $V_{OC}$ 期待値  
    SHJセルの発電特性
4. まとめ

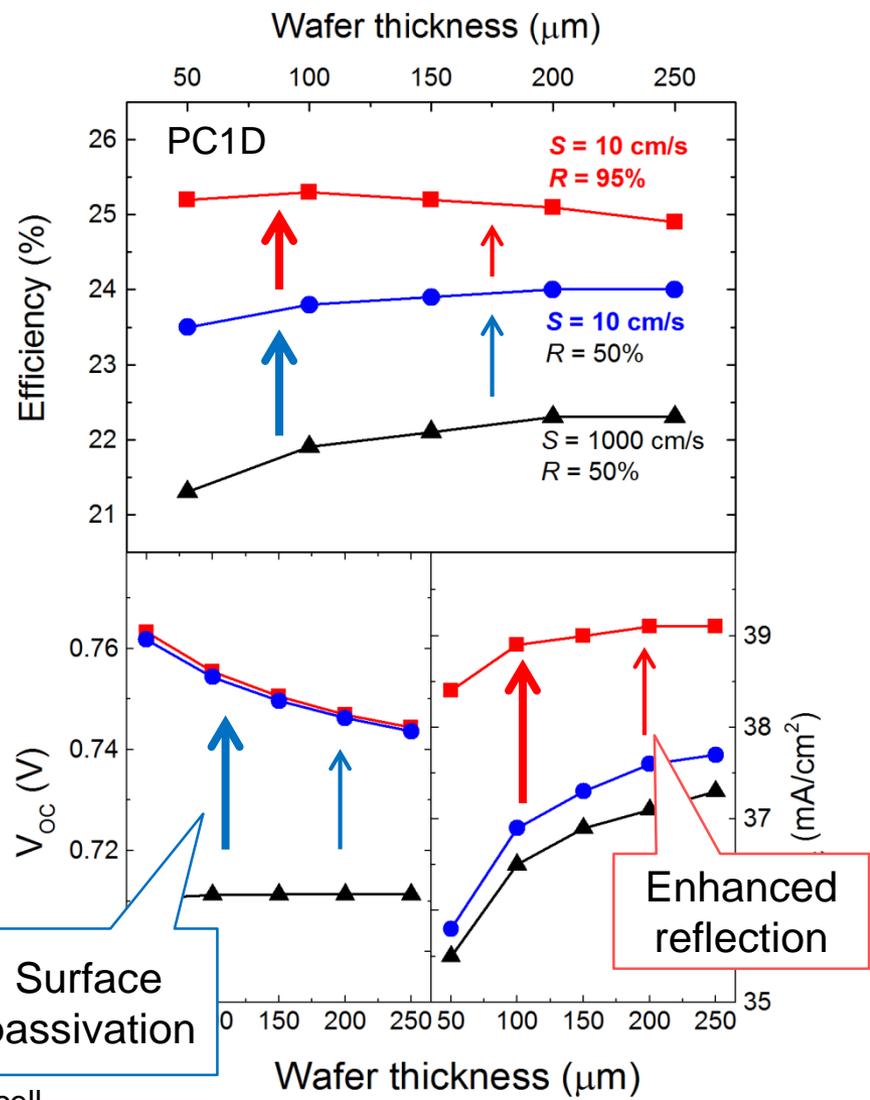
# 1.1. c-Siウェーハの薄型化 Toward thinner wafers

## ■ Module cost breakdown: wafer-related



## ■ Improved rear passivation & reflection: Al-BSF → PERC etc.

Thinner wafers ● Lower cost  
 ● Higher  $\eta$



Al-BSF: Al back surface field, PERC: passivated emitter rear cell

# 1.2. 薄型・高効率c-Si太陽電池 high- $\eta$ c-Si cells

## ■ Re-assessment of $\eta$ limit

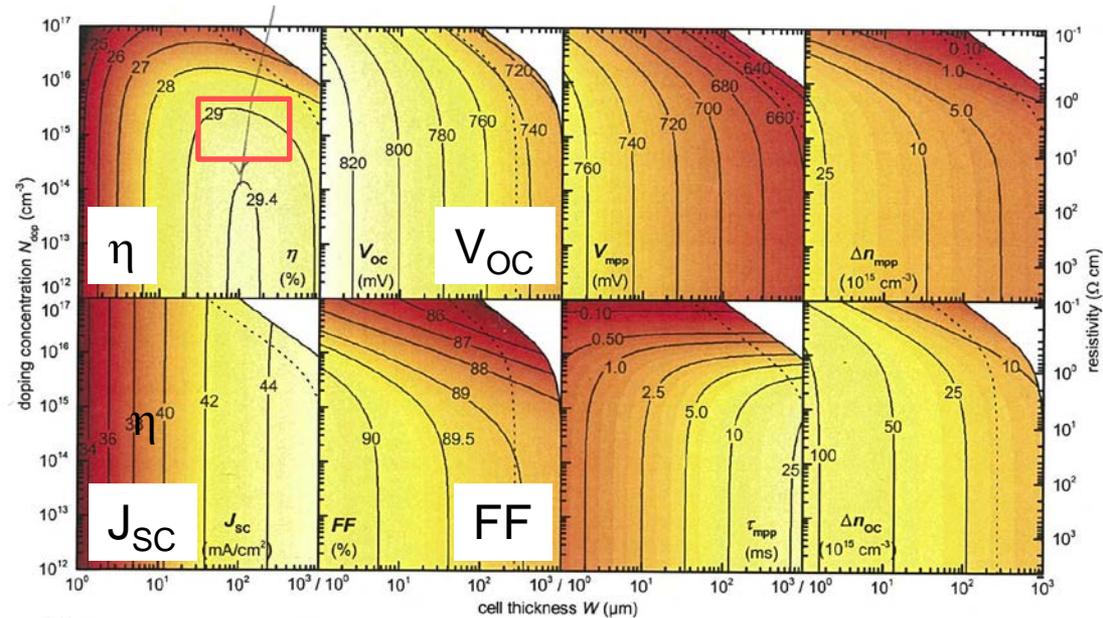
*A. Richter et al., IEEE JPV 3, 1184 (2013).*

### Intrinsic Si

- $\eta \sim 29.4\%$  at  $110 \mu\text{m}$

### n-type Si ( $2 \sim 10 \Omega\text{cm}$ )

- $\eta \sim 29\%$  for **50 ~ 300  $\mu\text{m}$**
- Trade-off:  $J_{sc} \downarrow$   $V_{oc} \uparrow$



## ■ Experimental data (thin wafers)

Cell type	t ( $\mu\text{m}$ )	$V_{oc}$ (V)	$\eta$	Institution
SHJ	98	0.750	24.7%	Panasonic <sup>[1]</sup>
Epi-IBC	35	0.687	21.2%	Solexel <sup>[2]</sup>
SHJ	50	0.753 <sup>local</sup>	N.A.	ASU <sup>[3]</sup>

SHJ: silicon heterojunction, IBC: interdigitated back contact

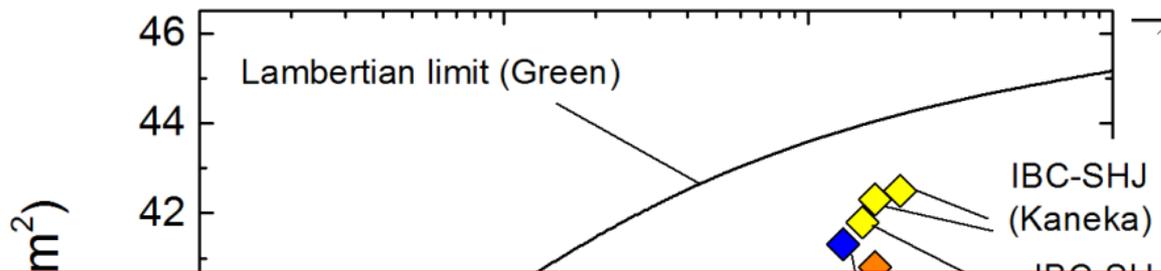
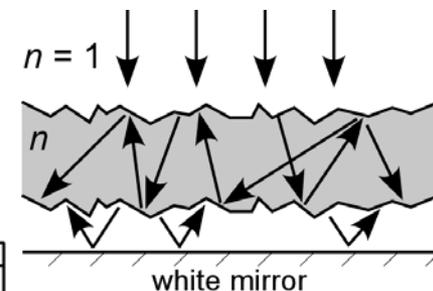
[1] Taguchi et al, IEEE JPV. 4, 96 (2014).

[2] Moslehi et al., PV Asia Pacific Conf. (2012)

[3] Herasimenka et al., APL. 103, 053511 (2013).

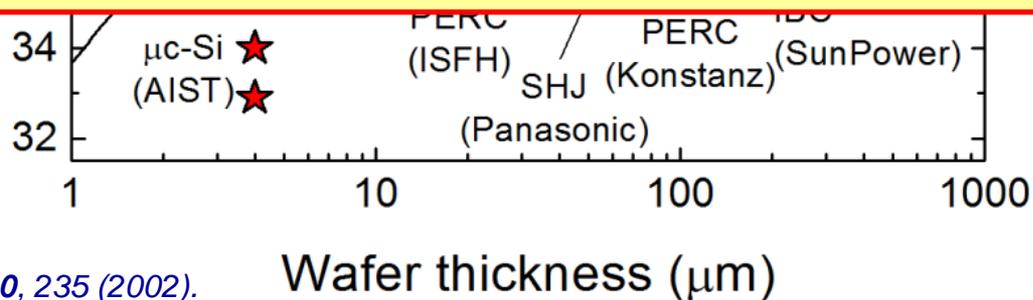
# 1.3. 薄型ウェーハと光閉じ込め Light trapping

## ■ Theory (Lambertian limit) & experimental data



$t < 100 \mu\text{m}$ を視野に、ウェーハ(発電層)薄型化が太陽電池特性( $V_{OC}$ ,  $J_{SC}$ )に及ぼす影響を検証し、極薄セルの可能性を**実験的に**明らかにする。

今回:  $J_{SC}$ および $V_{OC}$ の期待値( $iJ_{SC}$ ,  $iV_{OC}$ )を中心に議論

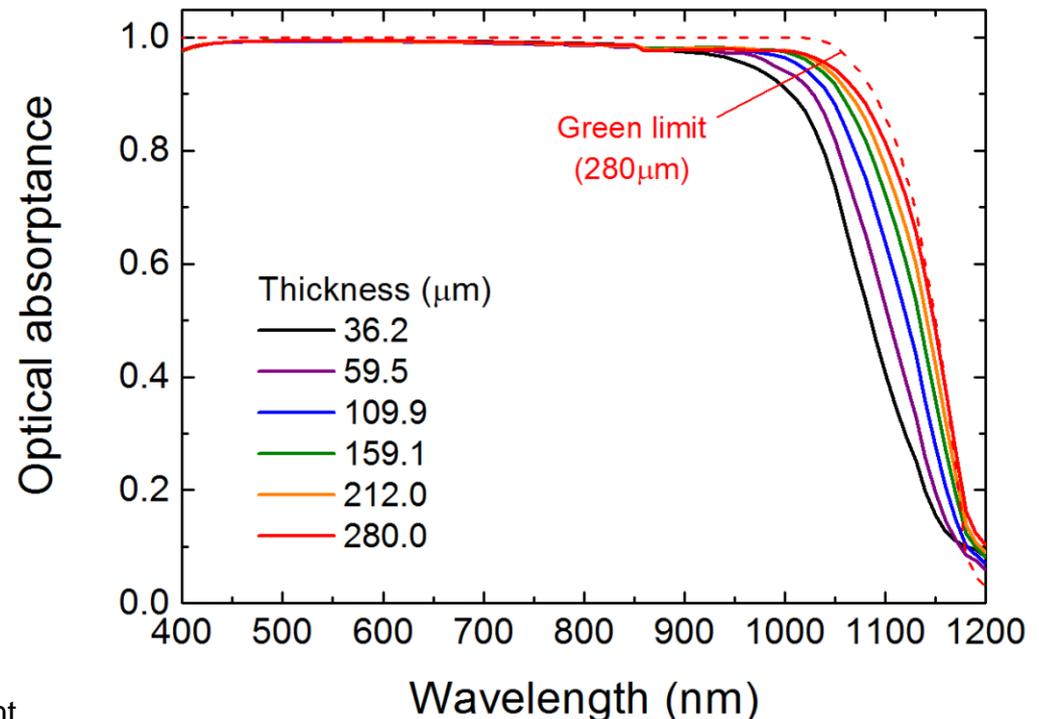
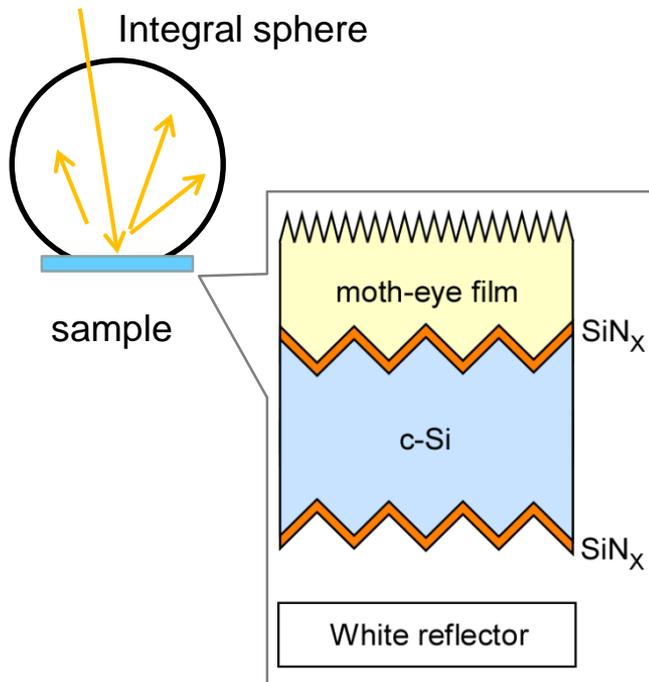


M. A. Green, *Prog. Photovolt.* **10**, 235 (2002).  
 K. Yoshikawa et al., *Nature Energy* **2**, 17032 (2017).  
 Kaneka press release, [http://www.kaneka.co.jp/kaneka-e/images/topics/1473811995/1473811995\\_101.pdf](http://www.kaneka.co.jp/kaneka-e/images/topics/1473811995/1473811995_101.pdf)  
 K. Masuko et al., *IEEE J. Photovolt.* **4**, 1433 (2014). B. Terheiden et al., *Phys. Status Solidi A* **212**, 13 (2015).  
 W. Deng et al., *Energy Procedia* **92**, 721 (2016). J. H. Petermann et al., *Prog. Photovolt.* **20**, 1 (2012).  
 M. A. Green et al., *Prog. Photovolt.* **25**, 3 (2017). H. Sai et al., *Appl. Phys. Lett.* **106**, 213902 (2015).

## 2.1. 極薄ウェーハの光吸収評価 – implied $J_{SC}$

- Dummy cell: random pyramid + ARC + rear reflector
- Thickness: 30 ~ 300  $\mu\text{m}$ ※, controlled by grinding
- Optical abs.  $\rightarrow$  implied  $J_{SC}$  ( $iJ_{SC}$ )

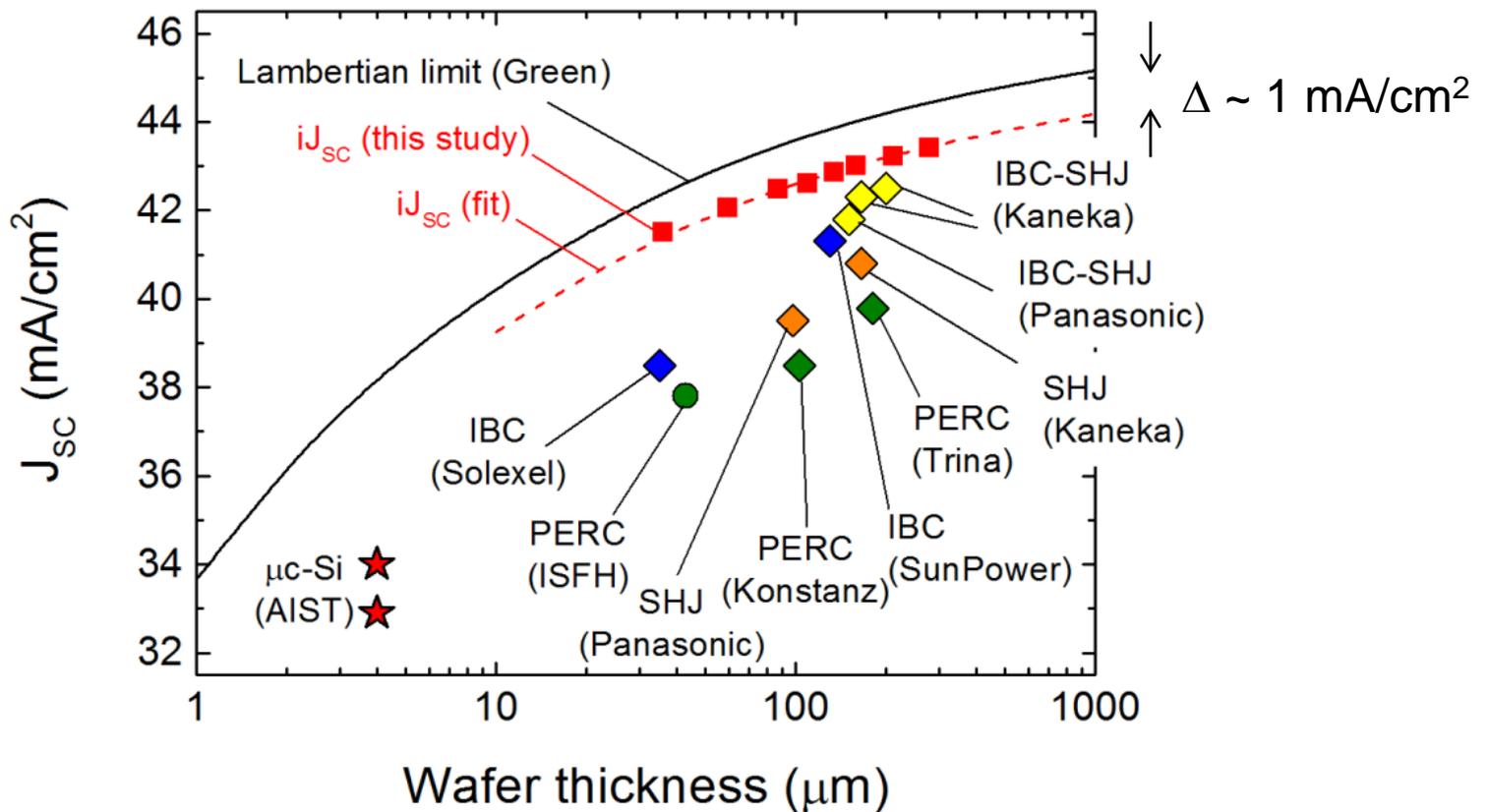
$$\text{Implied } J_{SC} = q \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \text{Abs}(\lambda) I_{AM1.5}(\lambda) d\lambda$$



※average thickness which is determined by wafer weight

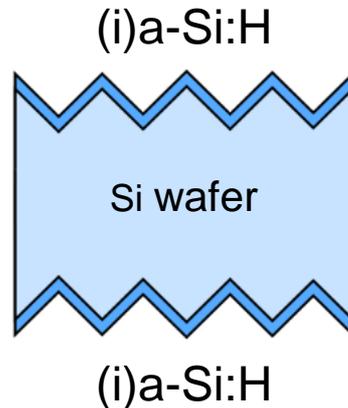
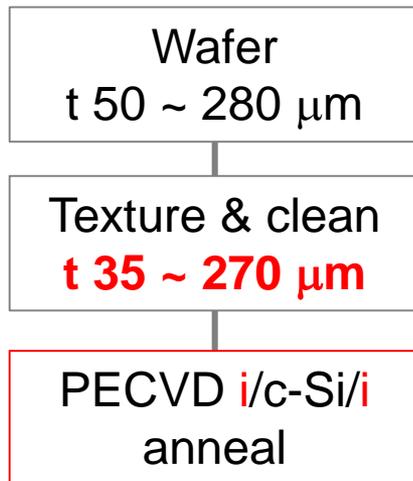
## 2.2. $J_{SC}$ の期待値 (implied $J_{SC}$ )

- Lambertian-like behavior down to  $t \sim 30 \mu\text{m}$ , with  $\sim \Delta 1 \text{ mA/cm}^2$ .
- $\Delta J (= iJ_{SC} - J_{SC})$  increases with decrease in wafer thickness.

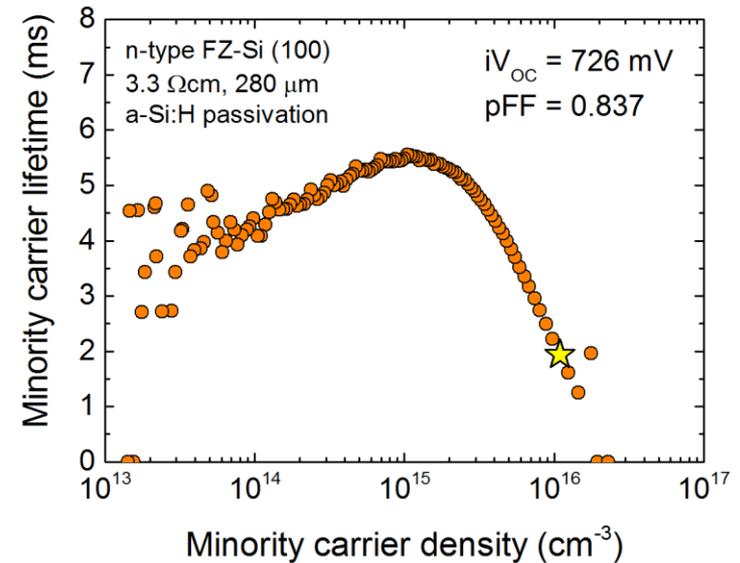


# 3.1. 薄型SHJセル: implied $V_{OC}$

- n-type, 1~3  $\Omega\text{cm}$ , CZ&FZ
- i/c-Si/i structure:  $iV_{OC}$  evaluation with QSSPC\*



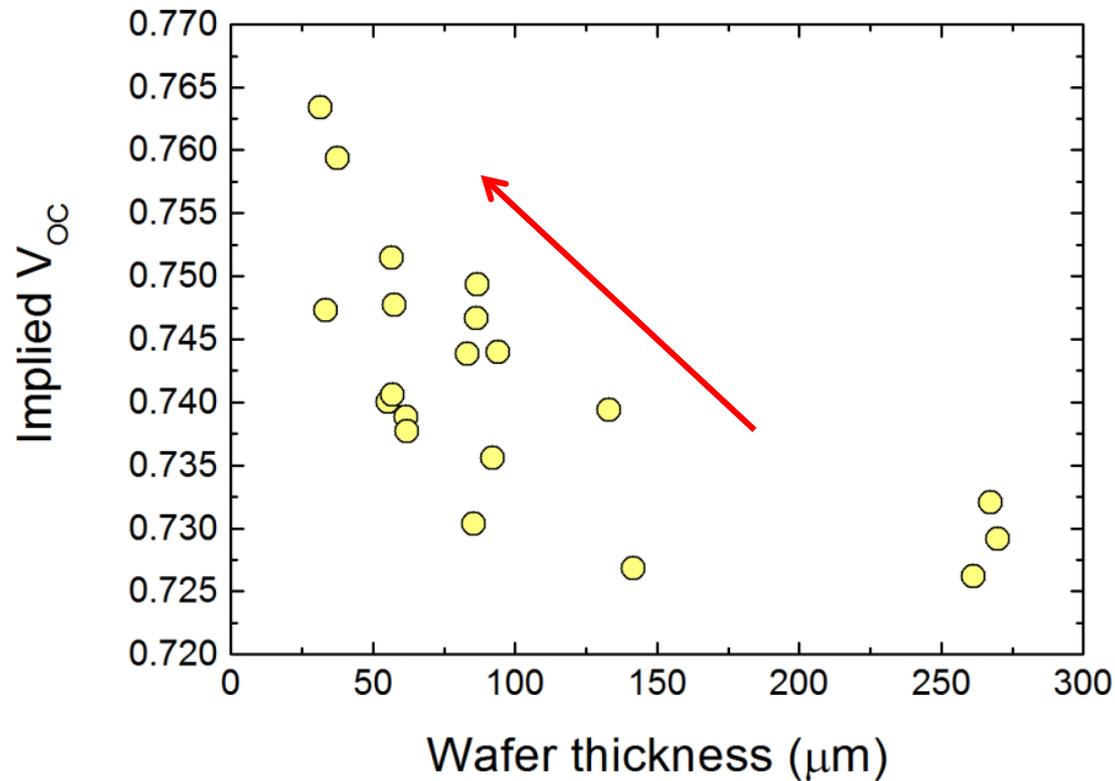
$$\text{Implied } V_{OC} = \frac{kT}{q} \ln \left\{ \frac{\Delta p(N_D + \Delta n)}{n_i^2} \right\}$$



QSSPC: quasi-steady state photo-conductance decay

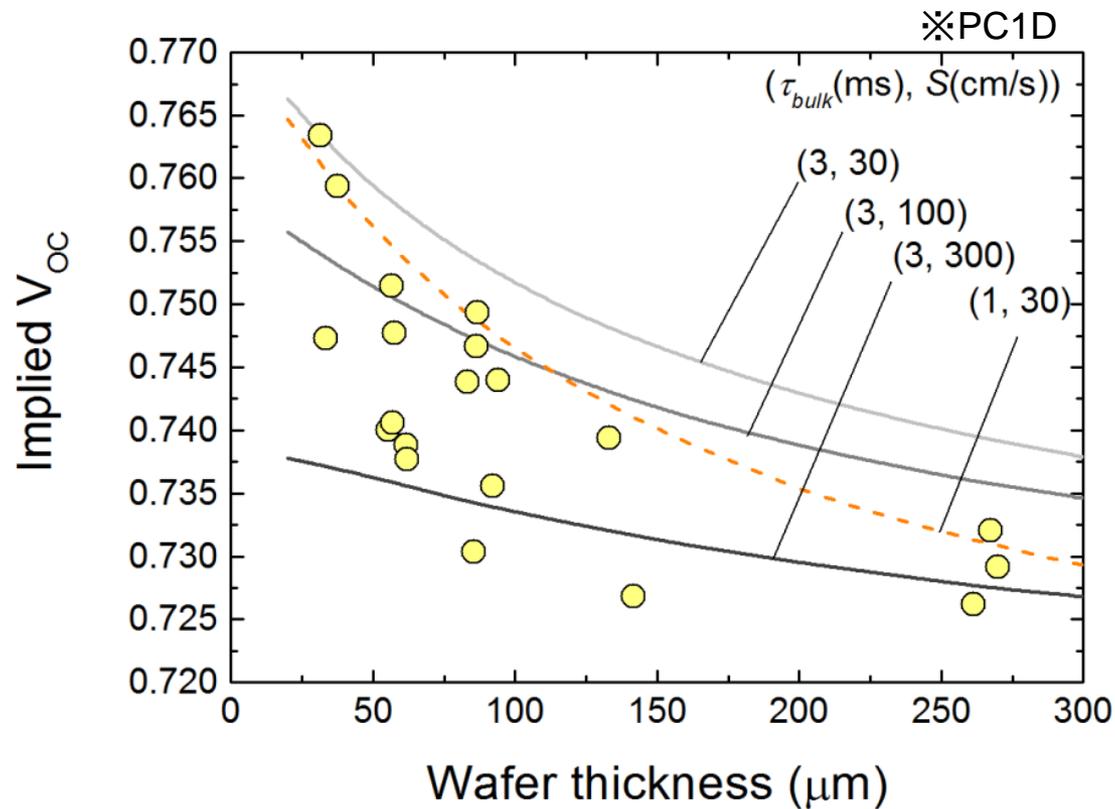
## 3.2. $iV_{OC}$ のウェーハ厚依存性

- $iV_{OC} > 0.760 \text{ V}$  for  $t < 50 \mu\text{m}$  ( $> 0.750 \text{ V}$  for  $< 100 \mu\text{m}$ )
- Wafer thickness  $\leftrightarrow iV_{OC}$



## 3.2. $iV_{OC}$ のウェーハ厚依存性

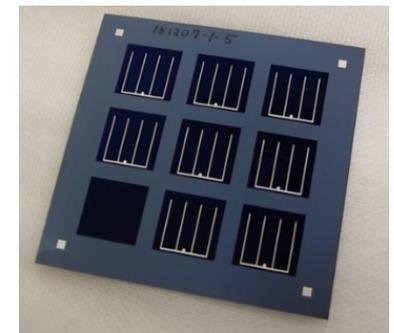
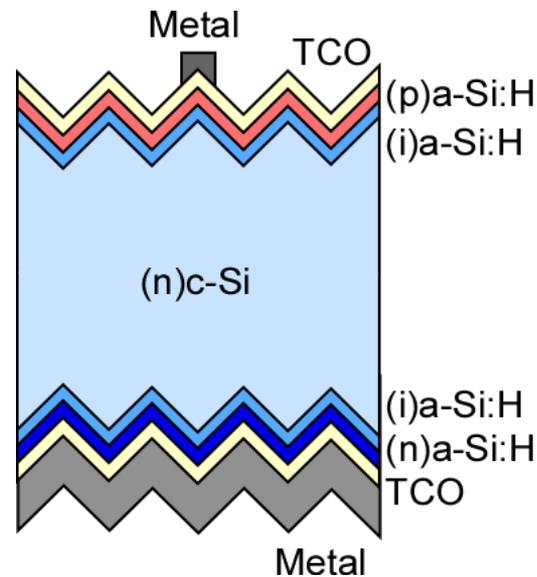
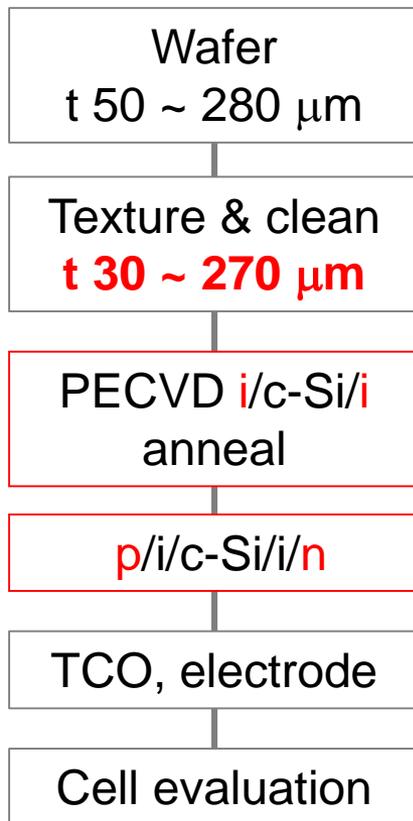
- Matched with a curve for  $\tau_{bulk} > 1$  ms and  $S < 30$  cm/s  
 ⇒  $iV_{OC}$  enhancement by using thinner wafers was confirmed.



\*S: surface recombination velocity

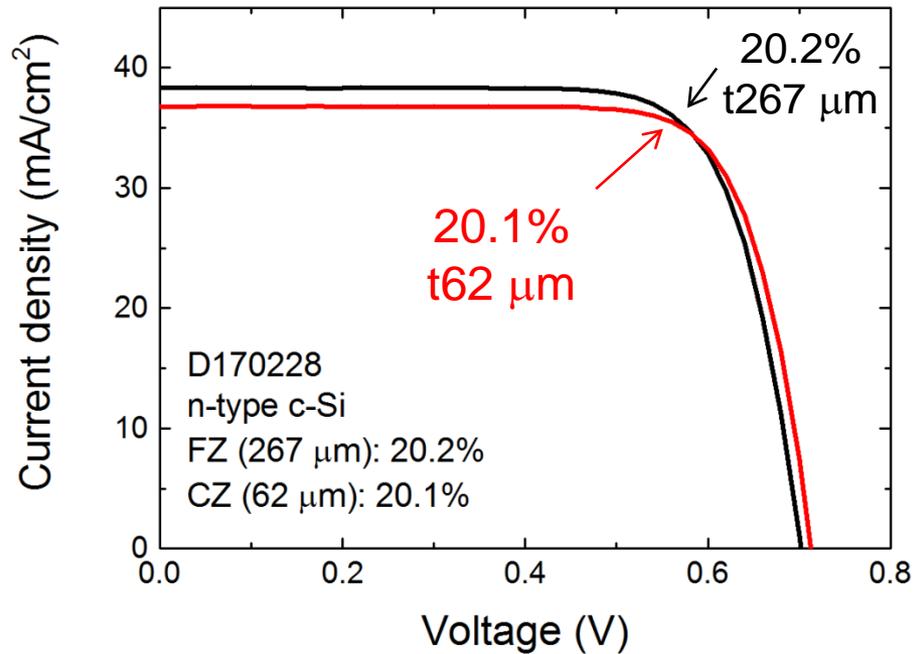
### 3.3. 薄型ウェーハを用いたSHJセル

- n-type, 1~3  $\Omega\text{cm}$ , CZ&FZ
- SHJ cell (SP-ITO, small area)



## 3.4. SHJセル 発電特性

- SHJ cell with  $t < 50 \mu\text{m}$  was successfully processed.
- $\eta(62 \mu\text{m}) = 20.1\%$ , **~99%** of  $\eta(267 \mu\text{m})$  in the same run.



t ( $\mu\text{m}$ )	$J_{sc}$ ( $\text{mA}/\text{cm}^2$ )	$V_{oc}$ (V)	FF	Eff. (%)
<b>31</b>	35.5	0.705	0.756	18.9
<b>62</b>	36.8	<b>0.713</b>	0.767	<b>20.1</b>
<b>91</b>	37.1	<b>0.708</b>	0.762	<b>20.0</b>
<b>267</b>	38.4	<b>0.702</b>	0.751	<b>20.2*</b>

\*Best result: 21.0%

# まとめ

- 極薄ウェーハ ( $t = 30 \sim 300 \mu\text{m}$ ) を用いた結晶シリコン太陽電池の可能性を実験的に検証
- 疑似セル (アルカリテクスチャ + ARC + 反射): 実験的に得られた光吸収量は Lambertian limit と類似の挙動。  $\Delta iJ_{\text{SC}} \sim 1 \text{ mA/cm}^2$ 。
- i/c-Si/i 構造: 実験的に得られた  $iV_{\text{OC}}$  はウェーハ厚減少とともに増加し、その挙動は理論予想に合致。  $iV_{\text{OC}} > 0.760\text{V}$  を確認。
- SHJセル: 極薄ウェーハ ( $t < 50 \mu\text{m}$ ) の SHJセル 実現。  $t = 62 \mu\text{m}$  での効率保持率  $> 99\%$ 。

## < 今後 >

- $iJ_{\text{SC}}$  と  $J_{\text{SC}}$ 、 $iV_{\text{OC}}(\text{max})$  と  $V_{\text{OC}}$  の差異に関する検討
- ワイヤスライス薄型ウェーハの検討 (今回は研削により薄型ウェーハを作製)

## < 謝辞 >



国立研究開発法人  
新エネルギー・産業技術総合開発機構